

主要半導体材料ガス等国内販売実績5年推移

(暦年:2008年~2012年)

一般社団法人 日本産業・医療ガス協会
 特殊ガス企画委員会

単位:kg

番号	ガス名称	化学記号	2008年 (平成20年)		2009年 (平成21年)		2010年 (平成22年)		2011年 (平成23年)		2012年 (平成24年)	
			需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比	需要量	前年比
1	アルジシ	AsH3	21,400	106%	15,600	73%	20,600	132%	16,400	80%	13,300	81%
2	ジボラン	B2H6	590	94%	430	73%	480	112%	540	113%	390	72%
3	三塩化ホウ素	BCl3	98,000	107%	101,100	103%	123,600	122%	120,700	98%	105,400	87%
4	四フッ化炭素	CF4	489,000	99%	357,500	73%	475,900	133%	494,900	104%	484,300	98%
5	三フッ化メタン	CHF3	85,200	115%	73,400	86%	86,100	117%	79,800	93%	78,300	98%
6	六フッ化エタン	C2F6	343,300	88%	206,500	60%	247,900	120%	227,300	92%	206,300	91%
7	八フッ化シクロブタン	C4F8	29,000	107%	40,700	140%	43,700	107%	48,200	110%	51,800	107%
8	塩素	Cl2	203,000	110%	172,900	85%	247,300	143%	347,800	141%	255,800	74%
9	ゲルマニ	GeH4	120	109%	110	92%	110	100%	240	218%	240	100%
10	臭化水素	HBr	83,000	115%	74,900	90%	94,300	126%	106,700	113%	95,000	89%
11	アンモニア	NH3	1,168,000	103%	979,400	84%	1,589,600	162%	2,488,200	157%	2,842,200	114%
12	三フッ化窒素	NF3	1,423,000	122%	1,232,600	87%	1,658,200	135%	1,637,600	99%	1,588,800	97%
13	一酸化二窒素	N2O	580,000	95%	490,700	85%	603,400	123%	593,400	98%	739,500	125%
14	ホスフィン	PH3	17,700	96%	11,700	66%	15,800	135%	12,400	78%	11,500	93%
15	モジラン	SiH4	407,000	117%	430,300	106%	547,500	127%	541,900	99%	323,500	60%
16	ジシラン	Si2H6	500	100%	550	110%	580	105%	*1			
17	ジクロロシラン	SiH2Cl2	155,000	103%	130,000	84%	160,000	123%	172,900	108%	166,100	96%
18	四フッ化ケイ素	SiF4	6,000	100%	6,000	100%	5,700	95%	5,700	100%	6,000	105%
19	TEOS	(C2H5O)4Si	378,000	111%	390,600	103%	424,500	109%	407,700	96%	399,600	98%
20	六フッ化硫黄	SF6	207,000	105%	186,300	90%	267,400	144%	267,400	100%	243,000	91%
21	六フッ化タンゲスト	WF6	86,000	110%	90,000	105%	108,000	120%	103,000	95%	100,000	97%
22	有機金属		1,750	117%	1,610	92%	2,470	153%	2,780	113%	3,040	109%
23	その他ガス	H2Se BF3、Si2H6 SiHCl3等										
年間需要金額(単位:億円)			552	117%	497	90%	603	121%	612	101%	534	87%

(注) *1 ジシラン:2011年よりその他ガス欄に移行